【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成24年10月11日(2012.10.11)

【公表番号】特表2009-537594(P2009-537594A)
【公表日】平成21年10月29日(2009.10.29)
【年通号数】公開・登録公報2009-043
【出願番号】特願2009-511484(P2009-511484)
【国際特許分類】
Ｃ０７Ｄ 307/89 (2006.01)
Ｂ０１Ｊ 27/198 (2006.01)
Ｃ０７Ｂ 61/00 (2006.01)
【ＦＩ】
Ｃ０７Ｄ 307/89 Ｃ
Ｂ０１Ｊ 27/198 Ｚ
Ｃ０７Ｂ 61/00 ３００

【誤訳訂正書】
【提出日】平成24年8月21日(2012.8.21)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ｏ－キシロールと酸素含有ガスとのガス状混合物を、主要反応器中で、互いに別々の温度調節可能な少なくとも２つの反応帯域に導通させ、その際、最も下流に置かれた反応帯域を、上流と境を接している反応帯域より低い温度で運転し、未反応のｏ－キシロール、無水フタル酸酸化不足生成物および無水フタル酸を含有するガス状の中間体反応生成物に変換し、および中間体反応生成物を後方反応器中に導入し、主要反応器から流出する中間体反応生成物を後方反応器中への入口前で冷却することにより、無水フタル酸をｏ－キシロールの接触気相酸化によって製造する方法において、
主要反応器中での反応帯域の温度を、中間体反応生成物中の未反応のｏ－キシロールの濃度が、中間体反応生成物中の有機成分の質量に対して０．５～５質量％であり、中間体反応生成物中のｏ－トリルアルデヒドの濃度は、０．２５～０．６質量％であるように調節することを特徴とする、無水フタル酸をｏ－キシロールの接触気相酸化によって製造する方法。
【請求項２】
中間体反応生成物中の無水フタル酸酸化不足生成物の濃度の総和は、少なくとも０．５質量％である、請求項１記載の方法。
【請求項３】
ｏ－トリルアルデヒドおよびフタリドの濃度の総和は、少なくとも０．５質量％である、請求項１または２記載の方法。
【請求項４】
中間体の反応生成物中のフタリドの濃度は、少なくとも０．２５質量％である、請求項１から３までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
反応帯域は、異なる活性の触媒を含む、請求項１から４までのいずれか１項に記載の方法。

【請求項６】
ガス状混合物の流れ方向で最も下流に置かれた反応帯域は、上流と境を接している反応帯域より高い活性を有する触媒を含む、請求項５記載の方法。
【請求項７】
ガス状混合物の流れ方向で最も下流に置かれた反応帯域は、酸化バナジウムおよび二酸化チタンを基礎とする少なくとも１つの触媒を含み、この場合活性材料のアルカリ金属含量は、０．２０質量％以下である、請求項５または６記載の方法。
【請求項８】
上流で、ガス状混合物の流れ方向で最も下流に置かれた反応帯域と境を接している反応帯域は、
ａ）その活性材料が銀、バナジウム、および場合によっては１つ以上の促進剤金属を含有する多重金属混合酸化物を含む１つ以上の触媒、
ｂ）酸化バナジウムおよび二酸化チタンを基礎とする１つ以上の触媒、この場合この活性材料のアルカリ金属含量は、０．１２質量％以上であり、活性材料の燐含量は、０．２０質量％以下であるか、または
ｃ）前記定義ａ）に記載の１つ以上の触媒と前記定義ｂ）に記載の１つ以上の触媒との組合せから選択された触媒を含む、請求項５から７までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
中間体反応生成物中のｏ－キシロールの濃度に対する測定値が得られ、この測定値から主要反応器中の反応帯域の温度に対する制御の干渉が形成される、請求項１から８までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
主要反応器中に流入するガス状混合物のｏ－キシロール負荷量は、少なくとも６０ｇ／Ｎｍ^{3}である、請求項１から９までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
後方反応器中で生じる反応熱の少なくとも一部分を伝熱媒体での間接的な冷却によって導出する、請求項１から１０までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
後方反応器を本質的に断熱的に運転する、請求項１から１１までのいずれか１項に記載の方法。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００９】
この課題は、ｏ－キシロールと酸素含有ガスとのガス状混合物を主要反応器中で、互いに別々の温度調節可能な少なくとも２つの反応帯域に導通させ、未反応のｏ－キシロール、無水フタル酸酸化不足生成物および無水フタル酸を含有するガス状の中間体反応生成物に変換し、および中間体反応生成物を後方反応器中に導入することにより、ｏ－キシロールの接触気相酸化によって無水フタル酸を製造する方法によって解決され、この方法は、主要反応器中での反応帯域の温度を、中間体反応生成物中の未反応のｏ－キシロールの濃度が、中間体反応生成物中の有機成分の質量に対して少なくとも０．５質量％であるように調節することによって特徴付けられる。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２５】

一般に、最も下流に置かれた反応帯域は、上流と境を接している反応帯域より低い温度、例えばそれぞれの反応帯域に対応配置されている伝熱媒体に対して少なくとも２℃、特に少なくとも４℃低い温度で運転される。包囲する伝熱媒体の最も低い温度は、反応帯域が運転される温度と見なされる。